



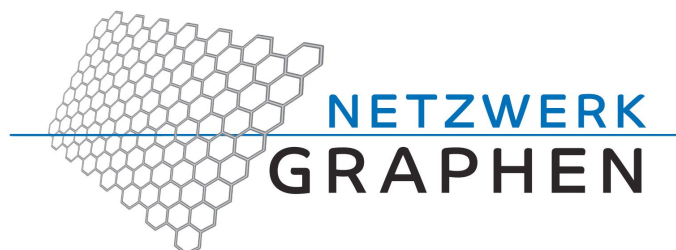
EINLADUNG ZUM NETZWERKSYMPOSIUM

1. März 2018 | 12:30 - 17:15 Uhr

Netzwerksymposium »Schützen und Veredeln von Oberflächen / Graphen«

Technische Hochschule Wildau
Haus 17, Raum 0030
Hochschulring 1
15745 Wildau

[Wir bitten um Anmeldung bis zum 26.2.2018](#)



Netzwerksymposium »Schützen und Veredeln von Oberflächen / Graphen« Donnerstag, 1. März 2018, an der TH Wildau.

Wir laden Sie herzlich zum Netzwerksymposium am 1. März 2018 in die Technische Hochschule Wildau ein.

Das Symposium findet im Rahmen der von der TH Wildau koordinierten Netzwerke „Schützen und Veredeln von Oberflächen“ und „Graphen“ statt. Ziel ist der Erfahrungsaustausch zwischen Fachleuten aus Industrie, Forschungseinrichtungen und Hochschulen mit Schwerpunkt auf den Themen „kohlenstoffbasierte Funktionsschichten“ und „Graphen“ sowie damit verbundener Materialien und Technologien.

Die Veranstaltung bietet die Gelegenheit, sich über Methoden der Schichtherstellung und Schichtanalytik sowie möglicher Anwendungen dieser Materialien in Form von Vorträgen, Posterbeiträgen und Diskussionen zu informieren. Sie bietet darüber hinaus die Möglichkeit, innovative Projektideen und Problemlösungen im Kreise von Fachleuten aus Wirtschaft und Wissenschaft zu diskutieren und Kooperationen anzubahnen.

Weitere Informationen zur Wissenschaftswoche finden Sie unter www.th-wildau.de/wissenschaftswoche

Die Teilnahme an der Fachtagung ist kostenfrei. Es wird um [Anmeldung](#) bis zum 26.2.2018 gebeten!

PROGRAMM TH-Campus, Haus 17, Raum 0030

12:30	Empfang und Anmeldung	15:35	Semiconducting two-dimensional WS₂-films: Preparation and Applications Stefan Seeger Optotransmitter Umweltschutz Technologie e.V.
13:00	Begrüßung Sigurd Schrader Technische Hochschule Wildau		
13:10	Toward the large-area synthesis of graphene and other 2D materials for nanoelectronics Marcelo Lopes Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik	16:00	Graphene and anti-reflective coatings using pulsed high-current arc evaporation Werner Gerlach-Blumenthal & Helge Lux FAP Dresden GmbH & TH Wildau
13:35	-Platzhalter- Michael Hornung AMO GmbH	16:25	Materials for micro electronic devices Anja Voigt micro resist technology GmbH
14:00	Atomic Layer Deposition for Graphene Applications Irina Kärkkäinen SENTECH Instruments GmbH	16:50	-Platzhalter- Andreas Mai IHP Frankfurt (Oder)
14:25	Ellipsometrische Klassifizierung von Kohlenstoffschichten Uwe Beck Bundesanstalt für Materialforschung und-prüfung	Ab 17:15 »GET TOGETHER« Bei einem kleinem Imbiss	
14:50	Kaffeepause und Posterausstellung	Laborrundgänge und Posterausstellung ■ Labor für Oberflächentechnik ■ Labor für Photonik und Analytik ■ Labor für Lasertechnik	

Stand 14.2.2018; Änderung vorbehalten